PAT-NO:

JP02000114281A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2000114281 A

TITLE:

METHOD AND DEVICE FOR DIE BONDING

PUBN-DATE:

April 21, 2000

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

COUNTRY

KIN, SOKON

N/A

AN, SHOTETSU

N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

N/A

APPL-NO: JP11270492

APPL-DATE: September 24, 1999

INT-CL (IPC): H01L021/52

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method and device for die bonding which can shorten the time required for die bonding.

SOLUTION: A die bonding device 200 comprises a semiconductor chip pickup stage 220 for inspecting the condition and position of a semiconductor chip, a chip alignment stage 240 where the semiconductor chip is fixed on a mount head for alignment, a guide rail 253 for transferring the semiconductor chip, CCD cameras 226, 257, and 264 for inspecting the conditions and position of a land pattern, an a bonding unit 260 for bonding the semiconductor chip. Since the

quality of the land pattern of a mount tape is decided before a chip transfer unit 230 picks up the semiconductor chip, occurrence of mismatching is prevented.

COPYRIGHT: (C)2000, JPO

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2000-114281 (P2000-114281A)

(43)公開日 平成12年4月21日(2000.4.21)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコート*(参考)

HO1L 21/52

H01L 21/52

F

審査請求 未請求 請求項の数17 OL (全 12 頁)

(21)出願番号

特願平11-270492

(22)出願日

平成11年9月24日(1999.9.24)

(31)優先権主張番号 1998P41085

(32)優先日

平成10年9月30日(1998.9.30)

(33)優先権主張国

韓国 (KR)

(71)出顧人 390019839

三星電子株式会社

大韓民国京畿道水原市八達区梅麓洞416

(72)発明者 金 相根

大韓民国忠清南道天安市新芳洞895番地ド

レ現代アパート103棟1103号

(72)発明者 安 承哲

大韓民国忠清南道天安市星井洞645-12

(74)代理人 100093779

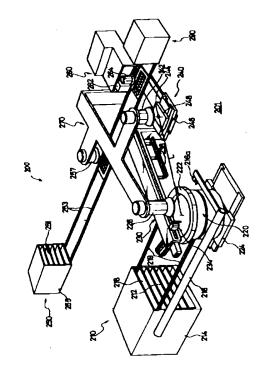
弁理士 服部 雅紀

(54) 【発明の名称】 ダイボンディング方法およびダイボンディング設備

(57)【要約】

【課題】 ダイボンディングに必要な時間を短縮するこ とができるダイボンディング方法及びダイボンディング 設備を提供する。

【解決手段】 ダイボンディング設備200は、半導体 チップの状態及び位置を検査する半導体チップピックア ップステージ220、半導体チップがマウントヘッドに 固定されアラインされるチップアラインメントステージ 240、半導体チップを移送するガイドレール253、 ランドパターンの状態及び位置を検査するCCDカメラ 226、257、264、ならびに半導体チップをボン ディングするボンディングユニット260を備える。半 導体チップをチップトランスファユニット230がピッ クアップする前にマウントテープのランドパターンの良 /不良を判定するので、ミスマッチングの発生を防止す ることができる。



20

【特許請求の範囲】

【請求項1】 微細間隔ボールグリッドアレーパッケー ジ用のダイボンディング方法であって、

1

マウントフレームに付着した半導体チップの品質、なら びに前記半導体チップがダイボンディングされるマウン トテープのランドパターンの品質を検査し、前記半導体 チップおよび前記ランドパターンの品質データおよび前 記品質データに対応する位置データを記憶手段に記憶す るデータ記憶段階と、

記憶された前記品質データおよび前記位置データに基づ 10 いてダイボンディングが実行されるダイボンディング領 域に位置するランドパターンの品質に対応する品質を有 する単数の半導体チップを選択するチップ選択段階と、 選択された半導体チップをアライメント領域に移送し、 移送した半導体チップに対し前記品質に対応する動作を 実行する動作段階と

を含むことを特徴とするダイボンディング方法。

【請求項2】 前記品質データは、良好データと不良デ ータとを含むことを特徴とする請求項1記載のダイボン ディング方法。

【請求項3】 前記動作段階は、移送された半導体チッ プが良好な半導体チップである場合、アライメントを実 行した後に前記ダイボンディング領域に位置するランド パターンに移送し、移送された半導体チップが不良な半 導体チップである場合、アライメントを実行せず前記ダ イボンディング領域に位置するランドパターンに移送す ることを特徴とする請求項2記載のダイボンディング方 法。

【請求項4】 前記ダイボンディング領域に位置するラ ンドパターンに良好な半導体チップを移送した後、良好 30 な半導体チップを前記ランドパターンに対し 2次アライ メントを実施することを特徴とする請求項3記載のダイ ボンディング方法。

【請求項5】 前記半導体チップの品質は半導体チップ ピックアップ領域に設置された半導体チップ検査用CC Dカメラにより検査され、前記ランドパターンの品質は 前記マウントテープを供給するマウントテープ供給ユニ ットと前記ダイボンディング領域との間に設置されたラ ンドパターン検査用CCDカメラにより検査されること を特徴とする請求項1記載のダイボンディング方法。

【請求項6】 前記ランドパターンの品質は、前記ダイ ボンディング領域に到達する前に検査されることを特徴 とする請求項5記載のダイボンディング方法。

【請求項7】 前記ランドパターン検査用のCCDカメ ラは、前記ランドパターンが一時停止するときに前記ラ ンドパターンの品質を検査することを特徴とする請求項 6記載のダイボンディング方法。

【請求項8】 前記ランドパターン検査用のCCDカメ ラは、前記ランドパターンが停止しない状態で前記ラン ドパターンの品質を検査することを特徴とする請求項6 50

記載のダイボンディング方法。

【請求項9】 前記チップ選択段階は、前記ダイボンデ ィング領域に位置するランドパターンの品質が良好な場 合、良好な半導体チップが選択され、前記ダイボンディ ング領域に位置するランドパターンの品質が不良な場 合、不良な半導体チップが選択されることを特徴とする 請求項2記載のダイボンディング方法。

【請求項10】 前記ダイボンディング領域に位置する ランドパターンの品質は良好であり前記マウントフレー ムで選択された半導体チップは不良である場合、不良な 半導体チップの位置を前記記憶手段に記憶し他の半導体 チップを検査して調査結果が良好な半導体チップを選択 することを特徴とする請求項9記載のダイボンディング 方法。

【請求項11】 前記ダイボンディング領域に位置する ランドパターンが不良である場合、前記半導体チップピ ックアップ領域とアライメント領域とを接続するチップ トランスファに設置されたチップ吸着部材の経路上に設 置された不良半導体チップトレーに不良半導体チップが 存在するか否かを判断する段階と、

前記不良半導体チップトレーに不良半導体チップが存在 しない場合、前記チップ吸着部材が前記記憶手段に記憶 されている前記マウントフレームの不良半導体チップの 位置に基づいて吸着した後、不良半導体チップを前記ア ライメント領域に移送する段階と、

をさらに含むことを特徴とする請求項10記載のダイボ ンディング方法。

【請求項12】 ウェハマウントフレームストッカから アンローディングされたウェハマウントフレームがロー ディングされ、半導体チップの状態およびそれに対応す る位置を検査する半導体チップピックアップステージ

前記半導体チップピックアップステージから所定の間隔 だけ隔離して設置され、前記半導体チップがマウントへ ッドに固定されアラインされるアラインメントステージ と、

前記半導体チップピックアップステージから前記アライ ンメントステージに前記半導体チップを移送するガイド レールと、

前記ガイドレールの上部の所定位置に設置され、前記マ ウントテープフレーム上のランドパターンの状態および それに対応する位置を検査する手段と、

前記ガイドレールにより移送されたマウントテープフレ ームのランドパターンに前記マウントヘッドに収納され た半導体チップをボンディングするボンディングユニッ **トと**.

を備えることを特徴とするダイボンディング設備。

【請求項13】 前記検査手段は、CCDカメラである ことを特徴とする請求項12記載のダイボンディング設

【請求項14】 前記チップトランスファは、立方体形 状の本体、前記本体に設置され直線往復移動装置により 往復移動する半導体チップ吸着ユニット、ならびに前記 半導体チップ吸着ユニットの移動経路上に少なくとも1 個以上の半導体を収納可能に設けられる半導体チップト レーを有することを特徴とする請求項12記載のダイボ ンディング設備。

【請求項15】 前記半導体チップトレーは、前記半導 体チップが収納される収納部が一列に形成されているこ とを特徴とする請求項14記載のダイボンディング設 備、

【請求項16】 前記半導体チップ吸着ユニットは、前 記本体の内部に所定の間隔で隔離されて配置されている 一対の滑車、前記滑車に取り付けられているテンション ワイヤ、前記テンションワイヤに結合され半導体を真空 圧で吸着し固定するチップ吸着モジュール、ならびに前 記一対の滑車のいずれかに結合され前記テンションワイ ヤを直線往復移動させることにより前記テンションワイ ヤに結合された前記チップ吸着モジュールを所定の距離 移動可能な駆動モータが設けられていることを特徴とす 20 る請求項14記載のダイボンディング設備。

【請求項17】 前記チップ吸着モジュールは、1つで あることを特徴とする請求項14記載のダイボンディン グ設備。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は微細間隙ボールグリ ッドアレーパッケージ用のダイボンディング方法及びダ イボンディング設備に関し、より詳細には半導体チップ とダイボンディングされる微細間隙ボールグリッドアレ 30 ーパッケージ用マウントテープのランドパターンの不良 有無を半導体チップをランドパターンに移送するチップ トランスファがピックアップする前の段階で全て判別し て、良品ランドパターンには良品半導体チップ、不良ラ ンドパターンには不良半導体チップがマッチングされる ようにして半導体チップとランドパターンの不良種類に よるミスマッチングを防止することにより、ダイボンデ ィング時間を短軸させた微細間隙ボールグリッドアレー パッケージ用のダイボンディング方法およびダイボンデ ィング設備に関するものである。

[0002]

【従来の技術】最近、半導体薄膜技術の発展に伴なって 完成された半導体チップをパッケージングする半導体パ ッケージ技術も急速に進歩している。既存の半導体パッ ケージに使用されたリードフレームの代りにフレキシブ ルなテープに所望する導電性パターンを形成して、導電 性パターンの一側端部にはソルダボールをアタッチして 他側端部は半導体チップの入出力端子であるボンディン グパッドにダイボンディングすることによりソルダボー ルを印刷回路基板に実装する方式を持つBGAパッケー 50 テーブル15からボンディングユニット20に半導体チ

ジが開発されている。

【0003】BGAパッケージはソルダボールアタッチ 工程を最後に実行することにより運搬および取扱が容易 であるとともに大量生産が可能で、従来リードフレーム 方式において必須であったトリミング、フォミングが不 必要である。最近はBGAパッケージの中でソリダボー ル間のピッチが数十µm~数百µm程度しかなく、半導 体チップの大きさの約120%に近接するチップスケー ルパッケージを実現可能な微細間隙ボールグリッドアレ 10 ーパッケージが開発された。

【0004】微細間隙ボールグリッドアレーパッケージ は、長い直四角形形状のポリイミード材質のベースポリ イミードテープにエッチング工法により所望する導電性 パターンとソルダボールが安着されるソルダボールパッ ドで形成されたランドパターンとを複数個形成する。

【0005】そして、導電性パターンの端部に該当する 部分であるビームリードが半導体チップのボンディング パッドとダイボンディングされるようにオープンウィン ドを形成する。テストを通して導電性パターンの中で短 絡された部分を検査し、不良ランドパターンには不良マ 一クを形成した後、応力緩衝部材である弾性重合体を付 着させる。

【0006】さらに、それをロール形態で捲取した後に 単位個数、例えばランドパターン3×10個が1つのべ ースマウントテープになるように切断し、切断されたべ ースマウントテープのエッジを四角リング形状のマウン トテープフレームに接着テープにより付着する。個別化 された半導体チップをベースマウントテープに形成され たそれぞれのランドパターンに移送した後、半導体チッ プのボンディングパッドとランドパターンの中でオープ ンウォンドに露出したビームリードを加圧ヘッドを通し てダイボンディングする。

【0007】以後、ダイボンディングが終了したベース マウントテープはソルダボールアタッチ工程を実行し、 ソルダボールはランドパターンのソルダボールパッドに アタッチされて複数個の微細間隙ボールグリッドアレー パッケージをベースマウントテープに形成する。ベース マウントテープに形成された複数個の微細間隙ボールグ リッドアレーパッケージをさらに個別化した後、テスト 40 を実行し微細間隙ボールグリッドアレーパッケージを製 作する。

【0008】図9は従来の微細間隙ボールグリッドアレ ーパッケージ用ダイボンディング設備を示す斜視図であ る。図9に示すように従来の微細間隙ボールグリッドア レーパッケージ用ボンディング設備100は、支持プレ ート1と、支持プレート1の所定領域に設置されたウェ ハマウントフレームストッカ5と、ベースマウントテー プストッカ10と、チップピックアップテーブル15 と、ボンディングユニット20と、チップピックアップ

ップを移送するチップトランスファ25と、ベースマウ ントテープストッカ10からボンディングユニット20 にベースマウントテープ30が付着されたベースマウン トテープフレーム35を移送するガイドレールユニット 40と、CCDカメラとから構成される。

【0009】また、多数の半導体チップが付着されたウ ェハマウントフレーム45を収納したウェハマウントフ レームストッカラからウェハマウントフレーム45がロ ーディング、アンローディング可能に開口50した部分 に対向してXY座標上で自由に動作できるチップピック 10 からガイドレール42、44に沿って所定距離だけ離隔 アップテーブル 15が設置される。

【0010】チップピックアップテーブル15には、四 角形状で複数個の不良半導体チップが収納される不良半 導体チップトレー55が固定されている。不良半導体チ ップトレー55は、チップピックアップテーブル15と ともに動作できるように構成される。

【0011】一方、チップピックアップテーブル15か ら所定間隔が離隔された位置には、半導体チップのロー ディングを受けてダイボンディングの前に半導体チップ のアラインメントを実行するとともに、チップピックア 20 ップテーブル15から半導体チップのローディングを受 けてポンディングユニット20に移送してダイボンディ ングを実行するマウントヘッド60が設置されたアライ ンメントテーブル65が設置される。

【0012】半導体チップのアラインメントを実行する ためアラインメントテーブル65は、チップピックアッ プテーブル 15と同様にXY方向に自由に動作可能であ るだけでなく、半導体チップの角度がダイボンディング の角度とはずれた状態であるときに半導体チップを回転 させアラインメントを実行するとともに Z軸への動作が 30 可能となるように構成される。このとき、チップピック アップテーブル15のウェハマウントフレーム45に付 着された半導体チップは、チップピックアップテーブル 15とアラインメントテーブル65とを往復運動するチ ップトランスファ25により移送される。

【0013】チップトランスファ25は、良品半導体チ ップが吸着固定される良品半導体チップコレット70 と、不良半導体チップを吸着固定する不良半導体チップ コレット75と、良品半導体チップコレット70および 対のコレット70、75の中でいずれの1つを選択する ための図示しないコレット選択装置が設置された移送ブ ロック80と、移送ブロック80を直線往復運動させる 図示しない直線往復運動機具とを含んでいる。

【0014】一方、ウェハマウントフレームストッカラ から所定間隔が離隔された位置には上述したベースマウ ントテープストッカ10が設置され、ベースマウントテ ープストッカ10に収納されたベースマウントテープフ レーム35がアンローディングされるように形成された る。

【0015】また、ガイドレールユニット40は、ベー スマウントテープフレーム35の側面が挿入されて移送 されるように所定間隔で形成された一対のガイドレール 42、44で構成され、ガイドレール42にはそれぞれ ベースマウントテープストッカ10からアンローディン グされたベースマウントテープフレーム35を移送する 図示しない移送機具が設置される。

【0016】一方、ベースマウントテープストッカ10 された位置にあるガイドレール42、44上にはボンデ ィングユニット20が設置される。ボンディングユニッ ト20は上下に動作する加圧ヘッド22および加圧ヘッ ド22とともに動作するボンディングユニットCCDカ メラ24から構成される。

【0017】このとき、ベースマウントテープフレーム 35を基準としてベースマウントテープフレーム35の 上部には加圧ヘッド22が位置し、下部にはマウントへ ッド60が位置し、加圧ヘッド22とマウントヘッド6 0は対向するように設置される。また、ボンディングユ ニットCCDカメラ24は、移送されたベースマウント テープフレーム35の位置を確認するとともに、ベース マウントテープが生産される過程で形成された不良マー クを確認する役割をする。

【0018】また、従来の微細間隙ボールグリッドアレ ーパッケージボンディング設備100にはボンディング ユニットCCDカメラ24以外にもソーイングされたウ ェハの中で不良半導体チップと良品半導体チップの位置 を判断するためのチップピックアップテーブルCCDカ メラ17と、アラインメントテーブル65のマウントへ ッド60に載置された半導体チップのアラインメントを 確認するためのアラインメントテーブルCCDカメラ6 2の2つのCCDカメラがさらに設置されている。

【0019】以上のように構成された従来の微細間隙ボ ールグリッドアレーパッケージボンディング設備の作用 について説明すると次のようである。まず、1枚のウェ ハの処理が終了し、他のウェハがローディングされた状 態において、一番目の作業が開始される場合、ベースマ ウントテープ30の中でボンディングが進行されるラン 不良半導体チップコレット75が設置されるとともに ・ 40 ドパターンが不良でありウェハマウントフレーム45上 に不良半導体チップがない場合、不良半導体チップロー ディング時間が増大されることを防止するため、作業者 は作業が開始される前にウェハマウントフレーム45に ソーイングされたウェハの中で不良半導体チップを選別 し上述した不良半導体チップトレー55に手作業でロー ディングする。

【0020】次に、作業者により不良半導体チップトレ ー55に不良半導体チップが全てローディングされる と、1枚のウェハマウントフレーム45がウェハマウン 開口85からガイドレールユニット40が延長設置され「50」トフレームストッカ5からアンローディング機具により アンローディングされてチップピックアップテーブル1 5に固定される。

【0021】 継続して、チップピックアップテーブルC CDカメラ17を利用してチップピックアップテーブル 15の半導体チップを撮像し良品半導体チップと不良半 導体チップを判別する。すると、チップトランスファ 2 5の良品半導体チップコレット70の下部に良品半導体 チップが位置されるようにチップピックアップテーブル 15がXYテーブルにより駆動され、良品半導体チップ コレット70はボンディング時間を短縮するため良品半 10 導体チップを吸着固定して待機する。

【0022】次に、良品半導体チップが良品半導体チッ プコレット70により吸着固定されて待機状態になると 同時に、ベースマウントテープフレーム35がマウント テープストッカ10からアンローディングされガイドレ ールユニット40に沿ってボンディングユニット20に 移送される。そして、加圧ヘッド22のボンディングユ ニットCCDカメラ24はベースマウントテープ30に 形成された複数個のランドパターンの中で最初の作業が 進行されると予定された一番目のランドパターンを撮像 20 し、不良ランドパターンであるか良品ランドパターンで あるかを判別する。

【0023】このとき、ボンディングユニットCCDカ メラ24が判別した一番目の該当ランドパターンが良品 である場合、良品半導体チップコレット70に吸着固定 された良品半導体チップはアラインメントテーブル65 のマウントヘッド60に移送されアラインメントされ る。アラインメントが終了された良品半導体チップはマ ウントヘッド60によりベースマウントテープ30の該 当良品ランドパターンに移送された後、加圧ヘッド22 30 は下方に下降しマウントヘッド60は上方に上昇しなが ら良品半導体チップのボンディングパッドと良品ランド パターンのビームリードをボンディングする。

【0024】一方、ボンディングユニットCCDカメラ 24が判別した一番目のランドパターンが不良ランドパ ターンである場合、良品半導体チップコレット70に吸 着固定された良品半導体チップは回送されて元の位置に 戻され、良品半導体チップコレット70の代りに不良半 導体チップコレット75が不良半導体チップをピックア ップしてマウントヘッド60に移送する。マウントヘッ 40 グに必要な時間を短縮させることにある。 ド60は他のアラインメント工程を実行しなかった状態 で不良ランドパターンに移送された後に加圧ヘッド22 は下方に下降しマウントヘッド60は上方に上昇しなが ら不良半導体チップのボンディングパッドと不良ランド パターンのビームリードがボンディングされる。上述の ように不良半導体チップと不良ランドパターンとをボン ディングする理由は後属工程であるソルダボールアタッ チ工程でのソルダボールアタッチエラーを最少化するた めである。

[0025]

【発明が解決しようとする課題】しかし、従来のボンデ ィング設備および方法によりダイボンディングを実行す る場合、ベースマウントテープの中でダイボンディング が実行されるランドパターンがボンディングユニットC CDカメラにより不良ランドパターンと判別されるとき に、既に前の段階でチップトランスファの良品半導体チ ップコレットが良品半導体チップをピックアップしてい る状態である。そのため良品半導体チップを元の位置に 戻し、良品半導体チップコレットの代りに不良半導体チ ップコレットがチップピックアップテーブルCCDカメ ラで判別した不良半導体チップをさらに吸着固定した 後、マウントヘッドに位置させることによりボンディン グ時間が遅延される問題点があった。

【0026】また、ボンディングユニットCCDカメラ がベースマウントテープのランドパターンの良否をダイ ボンディング時点で一つずつ判別することにより毎回ラ ンドパターンの判別に長時間が所要される問題点があっ た。

【0027】また、チップピックアップテーブルに固定 された不良半導体チップトレーに収納される不良半導体 チップをウェハマウントフレームから作業者が手作業で ビックアップして不良半導体チップトレーに移送させ口 ーディングしなければならないため、不良チップローデ ィング時間が増大される問題点があった。

【0028】また、作業者が不良半導体チップトレーに 収納された不良パッケージを使用する場合、XYテーブ ルが不良半導体チップトレーをチップトランスファの不 良半導体チップコレットの下方に移送しなければならな いため、不良半導体チップトレーに収納された不良半導 体チップピックアップ時間が増大される問題点があっ た。

【0029】したがって、本発明はこのような問題点に 着眼して案出されたもので、その第1目的は、半導体チ ップをトランスファするチップトランスファユニットが 半導体チップをピックアップする前に、半導体チップが ダイボンディングされるベースマウントテープの該当ラ ンドパターンの良否を先に判別して、それによってチッ プトランスファがランドパターンの種類に対応する半導 体チップをピックアップするようにしてダイボンディン

【0030】本発明の第2目的は、マウントテープのラ ンドパターンの不良可否をマウントテープがローディン グされる中に一回実行してマウントテープのランドパタ ーンの不良可否の判別時間を短縮させることにある。

【0031】本発明の第3目的は、複数個の不良半導体 チップが収納される不良半導体チップトレーを半導体チ ップトランスファのコレット低面にコレットの自取によ って設置することにより不良半導体チップをピックアッ プするためウェハ拡張テーブルが移動することが発生し

50 ないようにして不良半導体チップをピックアップする時

間を短縮させることにある。

【0032】本発明の第4目的は、不良半導体チップを 不良半導体チップトレーにローディングする作業を半導 体チップトランスファのコレットが実行するようにして 不良半導体チップトレーに不良半導体チップをローディ ングする時間を短縮させることにある。

9

[0033]

【課題を解決するための手段】本発明のダイボンディン グ設備およびダイボンディング方法によると、半導体チ ップをランドパターンにダイボンディングするため必要 10 な複数ランドパターンが形成されたベースマウントテー プをボンディング領域に移送する段階と、ボンディング 領域に移送されたベースマウントテープにダイボンディ ングされる半導体チップを移送する段階と、移送された ベースマウントテープおよび半導体チップをダイボンデ ィングする段階において、半導体チップをボンディング 領域に移送する段階の前の段階で移送されるベースマウ ントテープのランドパターンの良否を判断する段階を実 行することにより半導体チップとランドパターンの種類 ミスマッチングを防止し、ダイボンディング時間を短縮 20 させる。

【0034】ベースマウントテープをボンディング領域 に移送するとき、ベースマウントテープのランドパター ンをランドパターン認識用CCDカメラで撮像してラン ドパターン情報を獲得する。

[0035]

【発明の実施の形態】以下、図面に基づいて本発明の実 施例による微細間隙ボールグリッドアレーパッケージ用 ダイボンディング設備について詳細に説明する。 図1は 本発明の実施例による微細間隙ボールグリッドアレーパ 30 ッケージ用ダイボンディング設備(以下、ダイボンディ ング設備と称する)を示す斜視図である。

【0036】図1に示すようにダイボンディング設備2 00は、支持プレート201と、ウェハマウントフレー ム供給ユニット210と、チップピックアップステージ 220と、チップトランスファユニット230と、チッ プアラインメントステージ240と、ベースマウントテ ープ供給ユニット250と、ボンディングユニット26 0と、マウントテープフレームローダ290と、図示し ない制御モジュールと、ベースマウントテープ供給ユニ 40 ット250とボンディングユニット260との間に形成 されたCCDカメラとを含む。

【0037】制御モジュールは、マイクロプロセッサの ような制御ユニットと、処理されたデータを記憶する記 憶装置から構成される。好ましくは、記憶装置はデータ の入出力が可能な補助記憶装置であるハードディスクド ライブまたはRAM(Random Access Memory)である。 【0038】記憶装置には半導体チップの良否データと 判別された良品/不良品半導体チップの位置データが全 て記憶されるだけではなく、ベースマウントテープ25~50~ラインメント状態が確認できるようににする。

1のランドパターンに対する良、不良状態のデータとそ れに対応するランドパターンの良/不良位置データも記 憶される。

【0039】ウェハマウント供給ユニット210は、支 持プレート210に設置され、ウェハマウントフレーム 212が多数積層収納された六面体形状のウェハマウン トフレームストッカ214と、ウェハマウントフレーム ストッカ214からウェハマウントフレーム212をロ ーディングおよびアンローディングするマウントフレー ム移送装置216とから構成される。

【0040】マウントフレーム移送装置216は、ウェ ハマウントフレーム212を握持するグリッパー216 aがシリンダロッドの端部に設置された流体圧シリンダ で構成することが好ましい。

【0041】六面体形状のウェハマウントフレームスト ッカ214の一側面にはマウントフレーム移送装置21 6によりウェハマウントフレーム212がローディング およびアンローディング可能な開口218が形成され、 開口218と対向する支持プレート201にはチップピ ックアップステージ220が形成される。

【0042】チップピックアップステージ220は、リ ング形状のステージ222と、制御モジュールの制御信 号によりステージ222をXY平面上で自由に移送させ るXYテーブル224とから構成される。チップピック アップステージ220の上部にはチップピックアップス テージCCDカメラ226が設置される。 チップピック アップステージCCDカメラ226は、チップピックア ップステージ220にローディングされた半導体チップ の中で良品半導体チップならびに不良マークが形成され た不良半導体チップの正確な位置情報を獲得する。

【0043】チップピックアップステージ220とウェ ハマウントフレームストッカ214との間には、ウェハ マウントフレームストッカ214からアンローディング されたウェハマウントフレーム212をチップピックア ップステージ220に正確にガイドするとともに、ウェ ハマウントフレーム212がガイドされながらリング形 状のステージ222とアラインメントされるようにする マウントフレームガイドレール219が設置される。

【0044】支持プレート201の中でチップピックア ップステージ220から所定間隔離隔された位置には、 チップピックアップステージ220から移送された半導 体チップを固定した状態で半導体チップをXY軸に移送 および回動させて指定された位置にアラインメントさせ るチップアラインメントステージ240が設置される。 【0045】チップアラインメントステージ240の上 部にはアラインメントステージCCDカメラ242が設 置される。 アラインメントステージCCDカメラ242 はチップアラインメントステージ240に形成されたマ ウントヘッド244に吸着固定された半導体チップのア

12

【0046】制御モジュールの制御信号によって作動す るチップアラインメントステージ240は、XY軸方向 に移動可能なXYテーブル246と、XYテーブル24 6の上面に設置されたステージ248と、ステージ24 8に設置されて半導体チップを吸着固定するとともにス テージ248に対して回動可能であることによりアライ ンメント位置を正確に設定するマウントヘッド244と から構成される。

1 1

【0047】図2はトランスファユニットとチップピッ クアップステージを示す斜視図であり、図3はトランス 10 ファユニットのトランスファユニット本体を除去した状 態を示す斜視図である。上述のようにチップピックアッ プステージ220からアラインメントステージ240に 半導体チップを移送するためには、図2および図3に図 示されるように、チップピックアップステージ220と チップアラインメントステージ240との間に形成され たチップトランスファユニット230を必要とする。

【0048】チップトランスファユニット230は、チ ップピックアップステージ220の中央部とアラインメ ントステージ240のマウントヘッド244との間の間 20 隔しより多少長いトランスファユニット本体232と、 コレットユニット234と、不良半導体チップトレー2 36とから構成される。

【0049】図3に示されるように、トランスファユニ ット本体232の内側の両端部分には回転可能な滑車2 37a、237bが設置され、滑車237a、237b には所定張力を持つテンションワイヤ238がかけられ ている。これにより、滑車237a、237bの中でい ずれの1つの滑車237bの回転中心にはサーボモータ 239の回転軸239aが結合され、テンションワイヤ 30 238はサーボモータ239の回転方向にしたがって直 線往復運動する。

【0050】 コレットユニット234は、 テンションワ イヤ238に結合され直線往復運動するガイドブロック 234 aと、ガイドブロック234 aと結合されたコレ ット支持本体234bと、コレット支持本体234bに 結合されたコレット234cと、半導体チップ側にコレ ット234cの変位が発生するように設置されたコレッ ト変位発生装置とから構成される。

【0051】不良半導体チップトレー236は、チップ 40 トランスファ230のトランスファユニット本体232 に設置され、トランスファユニット本体232の中でも 特にコレットユニット234の移送経路に沿って1列で 設置されコレットユニット234が不良半導体チップト レー236に不良半導体チップをローディングするため チップピックアップステージ220を駆動することなく 不良半導体チップをアンローディングできるように構成 される。

【0052】図1に示すように、チップアラインメント

ム251を移送する長いガイドレール253が配置され ている。ガイドレール253にはベースマウントテープ フレーム251の両側部が結合されガイドされるように 図示しないガイド溝が形成されている。ガイド溝にはベ ースマウントテープフレーム251を前進および後進さ せることが可能な図示しない駆動ローラーが設置され

【0053】ガイドレール253の両端部には、ベース マウントテープフレーム251が積層収納されたマウン トテープフレームストッカ255と、ダイボンディング が終了したベースマウントテープフレーム251が積層 収納されるマウントテープフレームローダ290とが設 置される。

【0054】ガイドレール253の中間部分にはダイボ ンディングが実行されるようにボンディングユニット2 60が設置され、ボンディングユニット260とマウン トテープフレームストッカ255との間にはランドパタ ーン良/不良確認用CCDカメラ257が設置される。 【0055】ランドパターンの良、不良確認用CCDカ メラ257は、先にベースマウントテープフレーム25 1のランドパターンを撮像しランドパターンの不良有無 を判別した後、判別されたランドパターンの良、不良デ ータによりコレット234がランドパターンの不良の有 無によって該当半導体チップをピックアップする。

【0056】ボンディングユニット260は、制御モジ ュールの制御信号により駆動される図示しないXYテー ブルと、XYテーブルに結合され移動可能な加圧ヘッド 262と、加圧ヘッド262に固定されたボンディング ユニットCCDカメラ264とから構成される。

【0057】ボンディングユニットCCDカメラ264 は、ボンディングの前にボンディングユニット260に 移送されたマウントテープのランドパターンと半導体チ ップのアラインメントを確認、補正する役割を有してい る。

【0058】図4にはカメラフレーム270に設置され たCCDカメラの位置が示されている。C1はチップピ ックアップステージの上部に位置したチップピックアッ プステージCCDカメラ226、C2はランドパターン の良、不良確認CCDカメラ257、C3はアラインメ ントステージCCDカメラ242、C4はボンディング ユニットCCDカメラ264である。

【0059】次に、微細間隔ボールグリッドアレーパッ ケージ用ダイボンディング方法を図5に基づいて説明す る。半導体薄膜技術により複数個の半導体チップが形成 されたウェハとウェハより大きい内径を持つウェハマウ **ントフレーム212とをマウント設備のマウンティング** ステージに位置させる。この状態でウェハマウントフレ ーム212とウェハの後面とを接着テープで固定付着さ せ、ウェハのスクラブインをブレード等によりソーイン ステージ240の近接にはベースマウントテープフレー 50 グしてウェハ上の半導体チップを個別化した後、ウェハ

マウントフレーム212をウェハマウントフレームストッカ214に多数枚ローディングさせる先行工程を実行する。

【0060】次に、S10段階で先行工程が終了されたウェハマウントフレーム212の中で1枚をマウントフレーム8送装置216によりチップピックアップステージ220のステージ222にアンローディングする。S20段階では、ステージ222にローディングされたウェハマウントフレーム212の個別化された半導体チップの中の1つをチップピックアップステージCCDカメ 10ラ226により検査し、良品半導体チップと不良品半導体チップとを区分する。

【0061】830段階で、半導体チップがボンディン グされるベースマウントテープが固定されたベースマウ ントテープフレーム251は、マウントテープフレーム ストッカ255からアンローディングされ、840段階 でベースマウントテープフレーム251はマウントテー プフレームストッカ255からアンローディングされば ンディングユニット260に移送される間にランドパタ ーン良/不良確認CCDカメラ257を通過する。この 20 とき、ランドパターン良、不良確認CCDカメラ257 によりベースマウントテープに形成された複数個のラン ドパターンは、良品ランドパターンと不良マークが形成 された不良ランドパターンとに区別された後、記憶装置 にランドパターンの良/不良データとして記憶される。 【0062】図7に示すようにランドパターン確認CC Dカメラ257は、先にランドパターンT11、T1 2、T13を撮像して発生したランドパターンの良/不 良データを図8のメモリテーブル500のT11、T1 2、T13に記憶する。このとき、T11、T13は不 30 良マーク251aがないため、良品ランドパターンと判 定されGとしてメモリテーブル500に記憶される。一 方、T12は不良マーク251aがあるため、不良ラン ドパターンと判定されてFとしてメモリテーブル500 に記憶される。このような過程を経由してT1列からT 10列に該当する30個のランドパターン良/不良デー 夕は全てメモリテーブル500に記憶される。

【0063】次に、S50段階でベースマウントテープフレーム251はボンディングユニット260に移送される。S60段階では、ベースマウントテープフレーム 40の良否検査が終了されランドパターン良/不良データが記憶されると、一番目のダイボンディング工程が進行される該当ランドパターンが良品ランドパターンであるかを判断する。

果、検査された半導体チップが良品半導体チップではない場合、S75段階では不良半導体チップの位置を記憶して、S77段階ではチップビックアップステージ220に存在する他の半導体チップの良否を検査する。

14

【0065】図6に示すように、不良半導体チップの位置は半導体チップを基準としてマトリックス形態で記憶される。例えば、[23]、[24]はそれぞれ2行3列、2行4列に該当する半導体チップが不良であることを示し、このデータは上述のように記憶装置に記憶される。【0066】S70段階での判断結果半導体チップが良品半導体チップである場合、S80段階では良品半導体チップをチップトランスファ230により吸着してピックアップする。S90段階で、チップトランスファ230によりピックアップされた良品半導体チップは、ボンディングユニット260に移送される前の段階でダイボンディング位置を正確にアラインメントするためチップアラインメントステージ240のマウントヘッド244

【0067】次に、S100段階でチップアラインメントステージ240に移送された良品半導体チップは、さらにアラインメントステージCCDカメラ242により撮像された後、良品半導体チップのアラインメント不良が発見された場合、良品半導体チップが安着されたマウントヘッド244をXYZ軸および所定角度回転させながらアラインメントを実行する。

に移送される。

【0068】S101段階で、チップアラインメントステージ240でアラインメントが実行された良品半導体チップを固定しているマウントヘッド244は、良品半導体チップをローディングしてボンディングユニット260に移送する。このとき、ボンディングユニット260にはS50段階によりベースマウントテープフレーム251が特機中であるため、ボンディングユニット260に良品半導体チップとベースマウントテープフレーム251とが全てローディングされる。S120段階ではボンディングユニット260のボンディングユニットCDカメラ264により該当良品ランドパターンの導電性パターンの端部に該当するビームリードと良品半導体チップのボンディングバッドが正確にアラインメントされたかを確認し、S130段階ではビームリードボンディングを実行する。

【0069】S140段階では、ベースマウントテープ に形成された多数個のランドパターンの中でダイボンディングが実行されるランドパターンが残っているかを判 断し、ボンディングが実行されたランドパターンがない 場合、ダイボンディングを終了する。また、ダイボンディングが実行されるランドパターンが残っている場合、記憶されたランドパターン良/不良データを参照してランドパターンにダイボンディングされるマウントテープ の半導体チップが良品半導体チップか不良半導体チップ かを判断する S20 B 段階にフィードバックする

【図面の簡単な説明】

【0070】S150段階では、S20段階で半導体チップ良否検査をさらに実行して半導体チップが良品であるか不良であるかを判断する。そして、その結果を記憶し、さらにボンディングが実行されるランドパターンが良品ランドパターンであるかを判断する。ダイボンディングされるベースマウントテープの該当ランドパターンが不良ランドパターンである場合、上述の不良半導体チップトレーに不良半導体チップが存在するかを判断する。

【0071】判断の結果、不良半導体チップが存在しな 10 い場合、S160段階ではS75段階で記憶された不良 半導体チップの位置を参照し、ウェハに位置した不良半 導体チップをピックアップする。判断の結果、不良半導 体チップが存在する場合、不良半導体チップトレーに位 置した不良半導体チップをピックアップする。

【0072】S170段階では、ピックアップされた不良半導体チップがチップトランスファ230によりチップアラインメントステージ240のマウントヘッド244に移送される。不良半導体チップがチップアラインメントステージ240に移送されると、S180段階で不20良半導体チップはアラインメント段階を実行せずボンディングユニット260に移送され、S190段階では不良ランドパターンと不良半導体チップのダイボンディング工程が進行される。

【0073】継続してS200段階では、ベースマウントテープに形成された多数個のランドパターンの中でダイボンディングが実行されるランドパターンが残っているか否かを判断し、ダイボンディングが実行されるランドパターンが残っている場合、S20段階にフィードバックし上述の過程を反復実行する。

【0074】判断の結果、それ以上はダイボンディング工程を進行するランドパターンがない場合、S210段階では後属ダイボンディング工程のため不良半導体チップトレー236に空間があるか否かを判断する。S220段階では不良半導体チップトレー236に空間にある場合、チップトランスファ230によりウェハマウントフレーム212の不良半導体チップを不良半導体チップトレー236に空間が存在しないようにローディングした後、作業を終了する。

[0075]

【発明の効果】以上のように本発明によると、ダイボンディングされる半導体チップをチップトランスファがピックアップする段階以前において、半導体チップがダイボンディングされるマウントテープの該当ランドパターンの良/不良を判定してミスマッチングの発生を防止する。これとともに不良半導体チップをボンディング設備が自動で不良半導体チップトレーに移送することにより設備の生産効率を増大させる効果がある。

【図1】本発明の実施例によるダイボンディング設備を 示す斜視図である。

16

【図2】本発明の実施例によるダイボンディング設備のトランスファユニットとチップピックアップステージを示す斜視図である。

【図3】本発明の実施例によるダイボンディング設備のトランスファユニット本体を除去した状態を示す図である。

0 【図4】本発明の実施例によるダイボンディング設備に 設置されたCCDカメラの位置を示す図である。

【図5】本発明の実施例によるダイボンディング方法を示す図である。

【図6】本発明の実施例によるダイボンディング方法を 示す平面図であって、ウェハマウントフレームに固定さ れたウェハを示す図である。

【図7】本発明の実施例によるダイボンディング方法を 示す平面図であって、ベースマウントテープフレームに 固定されたベースマウントテープを示す図である。

20 【図8】本発明の実施例によるダイボンディング方法を 示す機略図であって、ランドパターンが記憶されたメモ リテーブルを示す図である。

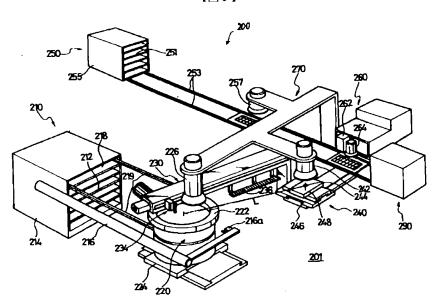
【図9】従来のダイボンディング設備を示す斜視図である。

【符号の説明】

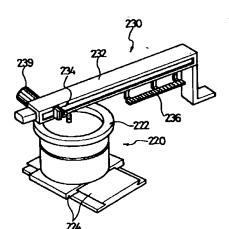
- 200 ボンディング設備
- 212 ウェハマウントフレーム
- 214 ウェハマウントフレームストッカ
- 216 マウントフレーム移送装置
- 30 219 マウントフレームガイドレール
 - 220 チップピックアップステージ
 - 226 チップピックアップステージCCDカメラ
 - 230 チップトランスファユニット
 - 232 トランスファユニット本体
 - 236 半導体チップトレー
 - 237a、237b 滑車
 - 238 テンションワイヤ
 - 239 サーボモータ
 - 240 チップアラインメントステージ
- 40 244 マウントヘッド
 - 250 ベースマウントテープ供給ユニット
 - 251 ベースマウントテープフレーム
 - 253 ガイドレール
 - 255 マウントテープフレームストッカ
 - 257 パターン良/不良確認CCDカメラ
 - 260 ボンディングユニット
 - 264 ボンディングユニットCCDカメラ

15

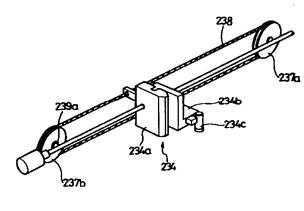
【図1】



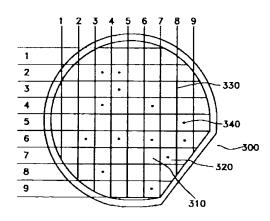
【図2】



【図3】

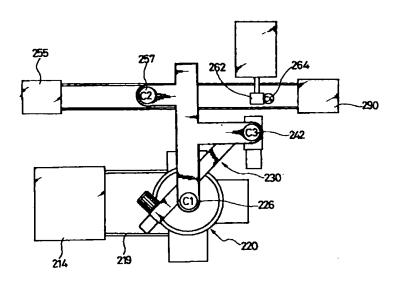


[図6]



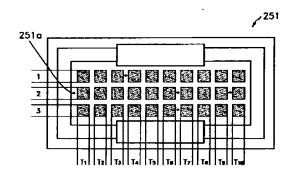
∕500

【図4】



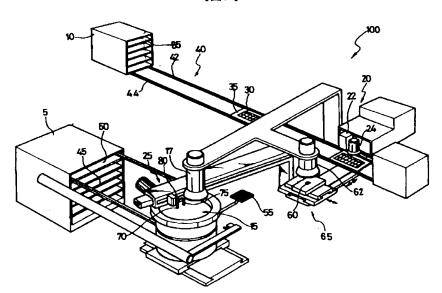
【図7】

【図8】



	Tı	Tz	Ts	T4	Ts	Ts	T ₇	Ta	To	T10
1	G	G	G	F	G	G	G	G	G	G
2	F	G	G	G	G	G	F	G	G	F
3	G	G	G	G	G	G	F	G	G	G

【図9】



【図5】

